

순번

291

기술명

유전체 창문 오염 방지 장치, 자체 플라즈마 광 방출 스펙트럼 장치, 및 입자 측정 장치

- 특허번호 : 10-2009-0092123
- 패밀리정보 : 없음
- 패키징특허 : 없음

• 보유기관 : 한국표준과학연구원

기술개요

- 진공 용기의 유전체 창문 오염 방지 장치
- 유전체 창문에 오염을 감소시킨 유전체 창문 오염 방지, 플라즈마 광 방출 스펙트럼 장치 및 입자 측정장치
- 활용처 : 반도체

기존 한계점

- 레이저 광 산란(Laser Light Scattering)법이나 흡광법(Laser Absorption)은 플라즈마 내에 존재하는 미세 입자의 크기를 알아내기 위한 방법임
- 두 기술에 사용되는 유전체 창문은 반도체 공정이 진행됨에 오염되어 주기적으로 세정될 필요가 있음

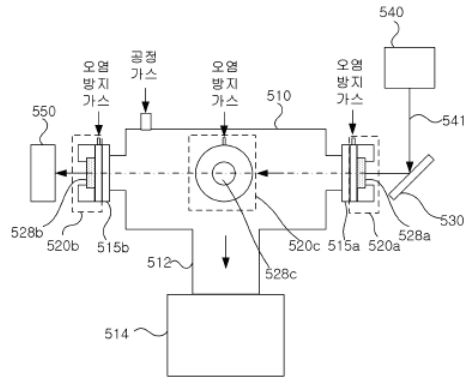
기술 차별점

- 유전체 창문 주위에 배치되는 노즐부는 노즐 입구(213a)에서 노즐 출구(213b)로 진행함에 따라 방향이 점진적으로 변화하여 오염 방지 가스에 회오리를 제공함
- 노즐부(27)는 상기 노즐 입구(213a)에서 상기 노즐 출구(213b)로 진행함에 따라 점진적으로 단면적이 감소하여 상기 오염 방지 가스를 가속할 수 있음

세부 내용

- 유전체 창문 오염 방지 장치는 노즐부가 구비되며, 유전체 창문의 주위에 배치됨. 유전체 창문에 오염 방지 가스를 분사하여 유전체 창문이 공정 가스 및 공정 부산물로부터 오염되는 것을 억제할 수 있음
- 노즐부는 나선형이고 노즐 출구로 갈수록 단면적을 감소시키어 상기 유전체 창문에 부착된 오염 물질을 탈착하게 할 수 있음

대표 이미지



문의처

- 국가과학기술연구회 공동TLO마케팅사무국 엄예지 선임연구원
- T. 042-862-6986 E-mail. yjeum@wips.co.kr

반도체 특이아이디
 첨단 분야 및 이들의
 생산·경영 관련 정보
 세상의 발달 방향대로
 분말 형태 금속 연료
 점적화로
 마스크 실재선(etch) 및
 이를 제조 관련 기기
 반도체 기판, 소자 및
 이를 제조 관련 기기
 무기-금속 복합재료
 또는 무기 복합재료
 탄소 소재